



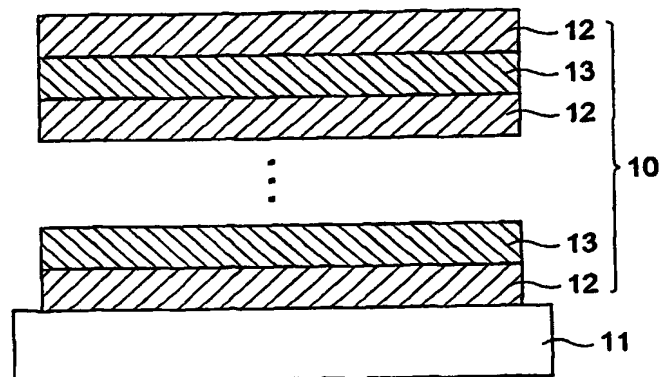
PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類7 G02B 1/10, H01L 21/027, G03F 1/14	A1	(11) 国際公開番号 WO00/58761 (43) 国際公開日 2000年10月5日(05.10.00)
(21) 国際出願番号 PCT/JP00/01950 (22) 国際出願日 2000年3月29日(29.03.00) (30) 優先権データ 特願平11/87275 1999年3月29日(29.03.99) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 ニコン(NIKON CORPORATION)[JP/JP] 〒100-8331 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 Tokyo, (JP) (72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 白井 健(SHIRAI, Takeshi)[JP/JP] 〒100-8331 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 株式会社 ニコン内 Tokyo, (JP) (74) 代理人 弁理士 長谷川芳樹, 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.) 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目6番12号 大倉本館 創英国際特許法律事務所 Tokyo, (JP)		(81) 指定国 DE, JP, US 添付公開書類 国際調査報告書

(54)Title: MULTILAYER ANTIREFLECTION FILM, OPTICAL COMPONENT, AND REDUCTION PROJECTION EXPOSURE SYSTEM

(54)発明の名称 多層反射防止膜、光学部材、及び縮小投影露光装置



(57) Abstract

A multilayer antireflection film comprises a laminated structure including at least one layer of low refractive index and at least one layer of high refractive index, which are alternately arranged. At least one of the outside layers of the laminated structure is a low refractive index, and the antireflection film prevents the reflection of light of s-polarization with a specific wavelength below 250 nm incident on the layer of low refractive index.